

京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点

利用負担金内規

(平成23年 3月 23日拠点マネージャー裁定)

(趣旨)

第1条 京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規(以下「利用内規」という。)第11条の規定に基づき負担すべき、装置等の利用負担金、基本料金及び技術料並びに実験室等の利用料金(以下「利用負担金等」という。)の額等については、この内規の定めるところによる。

(利用負担金等の額)

第2条 装置等を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金及び基本料金の合計額とする。

2 ナノテクノロジーハブ拠点(以下「ハブ拠点」という。)職員による装置等の使用が必要な技術相談を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金とする。

3 技術代行及び技術補助並びに事前講習(以下「技術代行等」という。)を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金及び技術料の合計額とする。

(利用負担金の額)

第3条 利用負担金の額は、別表第1に定める額とする。

2 利用負担金が、別表第2の負担上限額と同一の利用許可における利用負担金の累積額との差額を超える場合には、その差額を利用負担金の額とする。

(利用負担金の割り増し)

第4条 利用内規別表第1の微細構造解析装置群(別表第1のD)の装置等を成果非公開で利用する場合は、別表第1に定める額に2割5分増額した額を利用負担金とする。

(利用負担金の上限)

第5条 利用者は希望により別表第2の負担上限額をあらかじめ納付しておくことにより、装置等の利用負担金を都度納付することなく利用ができる。この場合、使用実績に応じた利用負担金の累積額が別表第2の負担上限額を下回る場合にも、いったん納付された負担上限額との差額は返還しない。

(基本料金の額)

第6条 基本料金の額は、別表第3に定める額とする。

(技術代行等における技術料の額)

第7条 技術代行等における技術料の額は、別表第4に定める額とする。

(サテライトラボ、セミナー室の利用料金の額)

第8条 実験室等のうち、サテライトラボ(専有部分)及びセミナー室を利用する場合の利用料金の額は、別表第5のとおりとする。

(利用負担金等の割引)

- 第9条 利用内規第5条第1項第1号及び第2号に掲げる者(以下「1号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習及び微細構造解析装置群利用者の技術補助の技術料に限る。)に定める利用負担金等の半額とする。
- 2 利用内規別表第1の微細加工装置群(別表第1のAからC)の装置等を利用する場合においては、利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業に則って研究成果を公開することについてあらかじめハブ拠点と合意した者(以下「成果公開利用者」という。)であって、その所属する機関が中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者(以下「2号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習の技術料に限る。)に定める利用負担金等の半額とする。
- 3 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、成果公開利用者であって、前項に掲げる者を除く者(以下「3号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習の技術料に限る。)に定める利用負担金等の8割に相当する額とする。
- 4 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、成果公開利用者であって、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者(以下「4号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習の技術料に限る。)に定める利用負担金等の半額とする。
- 5 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者であって、前項に掲げる者を除く者(以下「5号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習の技術料に限る。)に定める利用負担金等の8割に相当する額とする。
- 6 ハブ拠点で準備した標準試料を用いて、微細加工装置群を利用する事前講習を受講する者については、利用負担金等の額を別表第1に定める額の半額とする。ただし、前5項に掲げる者(1号利用者から5号利用者)については、前5項の規定による割引後の利用負担金等の半額とする。

(キャンセル料の額)

第10条 装置等の利用中止に係るキャンセル料の額は、別表第6に定める額とする。

(その他)

第11条 この内規に定めるもののほか、利用負担金等及びキャンセル料に関し必要な事項は、運営責任者が定める。

附 則

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月16日から施行する。

附 則

この内規は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年8月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1 装置等の利用負担金

装置等 装置群	機器名	利用料		設置場所	
		(一日当たり)	(一時間当たり)		
A ナノリソグラフィ 装置	高速高精度電子ビーム描画装置	422,960円	52,870円	イエロールーム	
	レーザー直接描画装置	114,800円	14,350円	イエロールーム	
	高速マスクレス露光装置	65,280円	8,160円	イエロールーム	
	レジスト塗布装置	12,720円	1,590円	イエロールーム	
	レジスト現像装置	12,720円	1,590円	イエロールーム	
	スプレーコータ	16,080円	2,010円	イエロールーム	
	ウエハスピン洗浄装置	23,600円	2,950円	イエロールーム	
	厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置	24,880円	3,110円	イエロールーム	
	両面マスクアライナー	45,600円	5,700円	イエロールーム	
	露光装置(ステッパー)	169,200円	21,150円	イエロールーム	
	ICP質量分析装置	39,280円	4,910円	イエロールーム	
	紫外線露光装置	7,040円	880円	イエロールーム	
	超微細インクジェット描画装置	17,200円	2,150円	イエロールーム	
	有機現像液型レジスト現像装置	16,880円	2,110円	イエロールーム	
	E B露光装置	15,440円	1,930円	桂クリーンルーム	
	ステッパ	149,600円	18,700円	桂クリーンルーム	
	移動マスク紫外線露光装置	69,040円	8,630円	桂クリーンルーム	
	両面マスクアライナー露光装置	10,800円	1,350円	桂クリーンルーム	
	大面積超高精度電子線描画装置	558,240円	69,780円	加工・評価室	
	B ナノ材料加工・創製 装置	真空蒸着装置	10,000円	1,250円	加工・評価室
多元スパッタ装置(仕様A)		64,640円	8,080円	加工・評価室	
多元スパッタ装置(仕様B)		61,600円	7,700円	加工・評価室	
電子線蒸着装置		50,720円	6,340円	クリーンルーム1	
プラズマCVD装置		102,720円	12,840円	クリーンルーム1	
熱酸化炉		14,960円	1,870円	クリーンルーム2	
電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置		58,000円	7,250円	クリーンルーム2	
ドライエッチング装置		14,480円	1,810円	クリーンルーム2	
深堀りドライエッチング装置		84,320円	10,540円	クリーンルーム1	
磁気中性線放電ドライエッチング装置		84,560円	10,570円	クリーンルーム1	
シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム		67,760円	8,470円	クリーンルーム1	
シリコン犠牲層ドライエッチングシステム		34,160円	4,270円	クリーンルーム2	
紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置		72,400円	9,050円	イエロールーム	
基板接合装置		65,760円	8,220円	イエロールーム	
集束イオンビーム/走査電子顕微鏡		207,120円	25,890円	加工・評価室	
赤外フェムト秒レーザー加工装置		56,800円	7,100円	加工・評価室	
レーザーアニール装置		53,840円	6,730円	加工・評価室	
レーザーダイシング装置		108,480円	13,560円	加工・評価室	
真空マウンター		8,480円	1,060円	加工・評価室	
紫外線照射装置		3,760円	470円	加工・評価室	
エキスパンド装置		2,000円	250円	加工・評価室	
ダイシングソー		9,840円	1,230円	加工・評価室	
ウェッジワイヤボンダ		4,240円	530円	加工・評価室BF	
ボールワイヤボンダ		4,320円	540円	加工・評価室BF	
ダイボンダ		3,920円	490円	加工・評価室BF	
ナノインプリントシステム		17,200円	2,150円	イエロールーム	
赤外透過評価検査/非接触厚み測定機		16,240円	2,030円	イエロールーム	
パリレン成膜装置		5,760円	720円	桂クリーンルーム	
ICP-RIE装置		8,080円	1,010円	桂クリーンルーム	
簡易RIE装置		5,200円	650円	桂クリーンルーム	
ウエハ接合装置		72,960円	9,120円	桂クリーンルーム	
ナノインプリント装置		2,800円	350円	桂クリーンルーム	
ダイシング装置		9,200円	1,150円	桂クリーンルーム	
C ナノ材料分析・評価 装置		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	77,200円	9,650円	加工・評価室
		分析走査電子顕微鏡	107,520円	13,440円	加工・評価室
		X線回折装置	43,520円	5,440円	加工・評価室BF
		触針式段差計1	7,360円	920円	加工・評価室
		触針式段差計2	7,360円	920円	クリーンルーム2
		マイクロシステムアナライザ	45,280円	5,660円	加工・評価室
		高速液中原子間力顕微鏡	41,120円	5,140円	加工・評価室BF
	走査型プローブ顕微鏡システム	37,360円	4,670円	加工・評価室BF	
	光ピンセット	31,360円	3,920円	加工・評価室	
	共焦点レーザー走査型顕微鏡	40,000円	5,000円	加工・評価室	
	全反射励起蛍光イメージングシステム	32,720円	4,090円	加工・評価室	
	長時間撮影蛍光イメージングシステム	24,880円	3,110円	加工・評価室	
	3D測定レーザー顕微鏡	16,080円	2,010円	加工・評価室	
	ゼータ電位・粒径測定システム	17,200円	2,150円	加工・評価室	
	分光エリブソメーター	26,480円	3,310円	加工・評価室	
	ダイナミック光散乱光度計	22,880円	2,860円	加工・評価室	
	パワーデバイスアナライザ	12,800円	1,600円	クリーンルーム2	
	(プローバ)	10,080円	1,260円	加工・評価室	
	インピーダンスアナライザ	5,280円	660円	加工・評価室BF	
	(真空プローバ)	39,520円	4,940円	加工・評価室BF	
	光ヘテロダイン微小振動測定装置	16,880円	2,110円	加工・評価室BF	
	超微小材料機械変形評価装置	16,880円	2,110円	加工・評価室BF	
	卓上顕微鏡(SEM)	6,240円	780円	クリーンルーム1	
	セルテストシステム	16,800円	2,100円	加工・評価室BF	
	高周波伝送特性測定装置	5,600円	700円	加工・評価室	
	(RFプローブキット)	2,320円	290円	加工・評価室	
	(ネットワークアナライザ)	5,680円	710円	加工・評価室	
	(半導体パラメータアナライザ)	5,600円	700円	加工・評価室	
D ナノ微細構造解析 装置	極低温高分解能透過電子顕微鏡	84,960円	10,620円	極低温電子顕微鏡棟9-1室	
	球面収差補正透過電子顕微鏡	64,400円	8,050円	極低温電子顕微鏡棟9-2室	
	モノクロメータ搭載低加速原子分解能分析電子顕微鏡	96,640円	12,080円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟3号室	
	集束イオンビーム装置	32,160円	4,020円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟6号室	
	精密イオン研磨装置	5,840円	730円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟6号室	
	ミクロトーム	5,840円	730円	極低温電子顕微鏡棟9-2室	
ディンプリング装置	2,880円	360円	共同研究棟CL-203室		

備考

1. 上記表中の利用料は、1日又は1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額を利用負担金とする。
2. 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用負担金を算出するものとする。
3. 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額を利用負担金とする。
4. 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、別表第3の基本料金を負担しなければならない。

別表第2 利用負担金の上限額

利用者種別	利用料（1テーマ当たり）
第9条に掲げる1号利用者、4号利用者及び5号利用者	324万円
上記以外の者	1,404万円

備考

- 1 上記表中の利用料は、1テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む。）である。

別表第3 装置等利用に係る実験室等の基本料金

利用料（1時間当たり）
1,000円

備考

- 1 上記表中の利用料は、1時間当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに実験室等の利用時間に乗じた金額を1人当たりの基本料金とする。
- 2 複数の者が実験室等を利用する場合については、上記1の1人当たりの基本料金に実験室等の利用人数に乗じた金額を基本料金とする。

別表第4 技術代行等における技術料

区分	1時間当たり	1日当たり
技術補助	3,400円	27,200円
技術代行	3,400円	27,200円
事前講習	3,400円	27,200円

備考

- 1 上記表中の料金は、1日又は1時間の技術代行等に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに利用日数又は利用時間数に乗じた金額を技術料とする。
- 2 1時間未満の技術代行等及び1時間を超える技術代行等に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術代行等として、技術料を算出するものとする。

別表第5 サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

実験室等	利用料	
	1日当たり	1時間当たり
サテライトラボ（専有部分）	165円	21円
セミナー室		

備考

- 1 上記表中の料金は、実験室等の床面積1平方メートルあたりの1日又は1時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む。）であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数に乗じた金額とする。
- 2 1時間未満の実験室等利用及び1時間を超える実験室等利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の実験室等利用として、利用料金を算出するものとする。
- 3 複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料金を合算した金額を利用料金とする。

別表第6 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区 分	キャンセル料
利用開始日の8日前から30日前まで	利用負担金の額の50%
利用開始日当日から7日前まで	利用負担金の額の100%

備 考

- 1 利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、第3条第1項及び第9条に基づき算出した額とする。
- 2 キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとする。